

04;09
©1993 $\alpha - \gamma$ ПЕРЕХОД И НЧ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
ВЧ РАЗРЯДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

В.А.Лисовский, В.Д.Егоренков, О.В.Красников

В связи с широким использованием ВЧ разряда в различных областях техники [1–8] большой интерес представляют исследования форм горения разряда и его перехода из слаботочного в сильноточный режим. Хорошо известно [1,2], что ВЧ разряд может гореть в α (слаботочном) и γ (сильноточном) режимах, причем переход из α в γ режим сопровождается увеличением разрядного тока и плотности плазмы. Вместе с тем, при переходе ВЧ разряда в инертных газах из слаботочного в сильноточный режим наблюдается немонотонное поведение активного ВЧ тока [6,7], т. е. с ростом ВЧ напряжения ток проводимости в цепи электродов после достижения максимума уменьшается, проходит через минимум и затем быстро увеличивается. Представляет интерес исследовать явления в газоразрядном промежутке, сопровождающие возникновение немонотонного поведения активного ВЧ тока в инертных газах.

В настоящей работе показано, что:

1) В ВЧ разряде низкого давления в аргоне наблюдается область немонотонного поведения плотности плазмы n_i в центральной части разряда, т.е. с ростом ВЧ напряжения n_i сначала увеличивается, достигает максимума, затем уменьшается и после прохождения минимума снова возрастает. При низких давлениях аргона немонотонное поведение плотности плазмы наблюдается одновременно с немонотонным поведением активного тока ВЧ разряда, при промежуточных же давлениях эти два явления существуют в различных диапазонах ВЧ напряжений.

2) В области немонотонного поведения плотности плазмы в ВЧ разряде возникают низкочастотные шумы и колебания повышенной амплитуды. Это явление нами идентифицировано как ионизационная неустойчивость (см., например, [9–14]).

Эксперименты проводились в аргоне в диапазоне давлений $p = 10^{-2}$ Тор при частоте ВЧ поля $f = 13.56$ МГц и расстояниях между параллельными плоскими электродами диаметром 100 мм из нержавеющей стали $L = 7 - 54$ мм, n_i измерялась одиночным зондом.

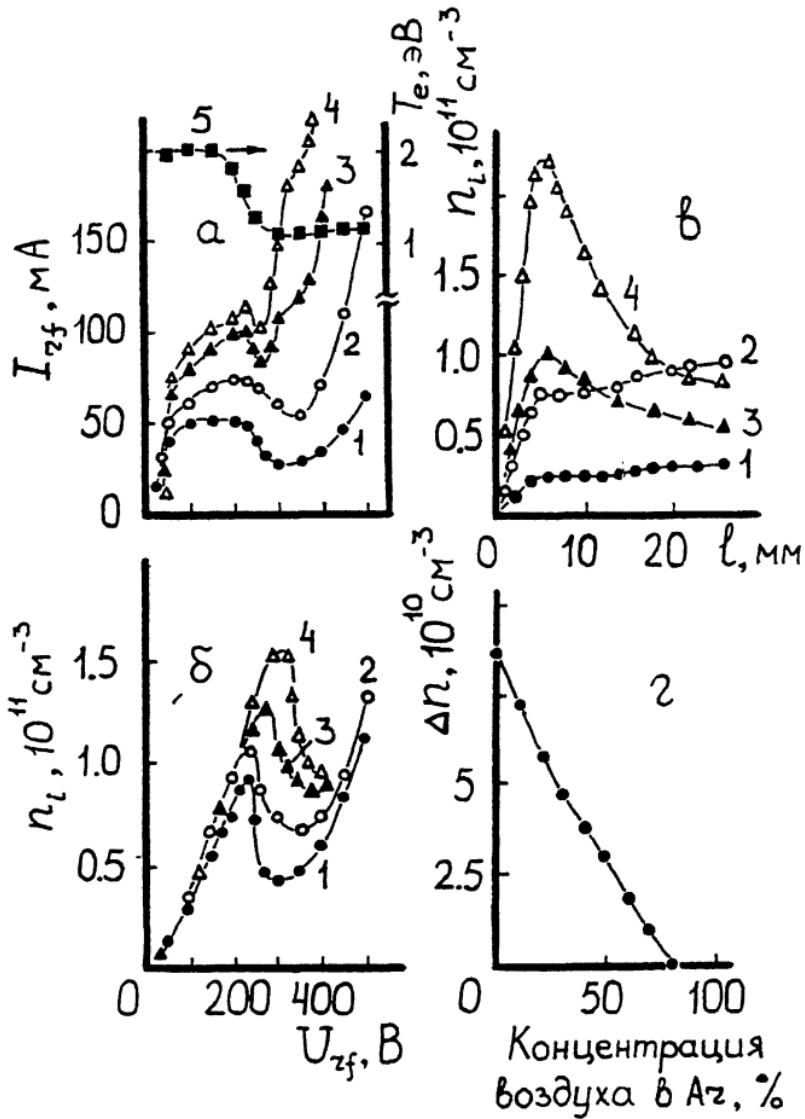


Рис. 1. Зависимость активного ВЧ тока в цепи электродов, температуры электронов в центре разряда (а) и плотности плазмы в центре разряда (б) от ВЧ напряжения при давлениях аргона: 1 — $p = 0.4$, 2 — 0.6, 3 — 0.8, 4 — 1.1 Тор; 5 — T_e при $p = 0.4$ Тор; в — осевое распределение плотности плазмы (от электрода до центра разряда) при $p = 0.5$ Тор: 1 — $U_{rf} = 75$ В, 2 — 190, 3 — 250, 4 — 350 В; г — зависимость величины Δn от концентрации воздуха в аргоне, $p = 0.4$ Тор. $L = 5.3$ см.

В диапазоне низких давлений аргона ($p < 0.5$ Тор при $L = 53$ мм) с ростом ВЧ напряжения сначала наблюдается увеличение плотности плазмы во всем разрядном объеме и активной составляющей ВЧ тока в цепи электродов; температура электронов T_e в разряде при этом сохраняет свое постоянное значение (рис. 1). При достижении некоторой величины ВЧ напряжения наблюдается одновременное уменьшение T_e и ВЧ тока; плотность плазмы n_i при этом растет только вблизи границ приэлектродных слоев, в центральных же областях разряда n_i резко уменьшается. В квазинейтральной плазме возникают низкочастотные ($f_n < 160$ кГц) шумы. При дальнейшем увеличении ВЧ напряжения разряд выходит из области отрицательной дифференциальной проводимости, ВЧ ток и плотность плазмы растут, T_e также медленно увеличивается. Низкочастотные шумы при этом исчезают.

При более высоких давлениях аргона ($p \geq 0.5$ Тор) уменьшение T_e и плотности плазмы в центре разряда наблюдается на возрастающей (сильноточной) ветви активного ВЧ тока, т.е. отрицательная дифференциальная проводимость и немонотонное поведение плотности плазмы в центре разряда находятся в разных диапазонах ВЧ напряжений. В центре разряда появляется положительный столб (ПС). С ростом ВЧ напряжения ПС постепенно исчезает, при этом n_i в центре разряда уменьшается и в плазме возникает ионизационная неустойчивость (низкочастотные плазменные шумы и колебания). На рис. 2, *a* показаны измеренный методом двух зондов дисперсионный закон $\omega = \omega(k)$ (ω — циклическая частота, k — волновое число колебаний), а также области существования и частота генерируемых колебаний. Полученный для ВЧ разряда закон дисперсии качественно совпадает с законом дисперсии бегущих струн в разряде на постоянном токе в аргоне [10]. Исследование поведения интегрального свечения ВЧ разряда во времени показало наличие бегущих струн, т.е. разряд в целом “мигает” с частотой генерируемых колебаний. При дальнейшем увеличении ВЧ напряжения n_i снова растет во всем разрядном объеме и ионизационная неустойчивость исчезает.

Введем величину $\Delta n = n_{\max} - n_{\min}$, описывающую уменьшение плотности плазмы в центре разряда (n_{\max} и n_{\min} — плотность плазмы в центре разряда в максимуме и минимуме зависимости $n_i = n_i(U_{rf})$ соответственно, U_{rf} — амплитуда ВЧ напряжения). Исследование влияния молекулярной примеси (воздуха) в аргоне на характеристики ВЧ разряда показало, что наиболее ярко немонотонное поведение плотности плазмы выражено в чистом аргоне; при концентрации аргона в воздухе менее 20% этот эффект не на-

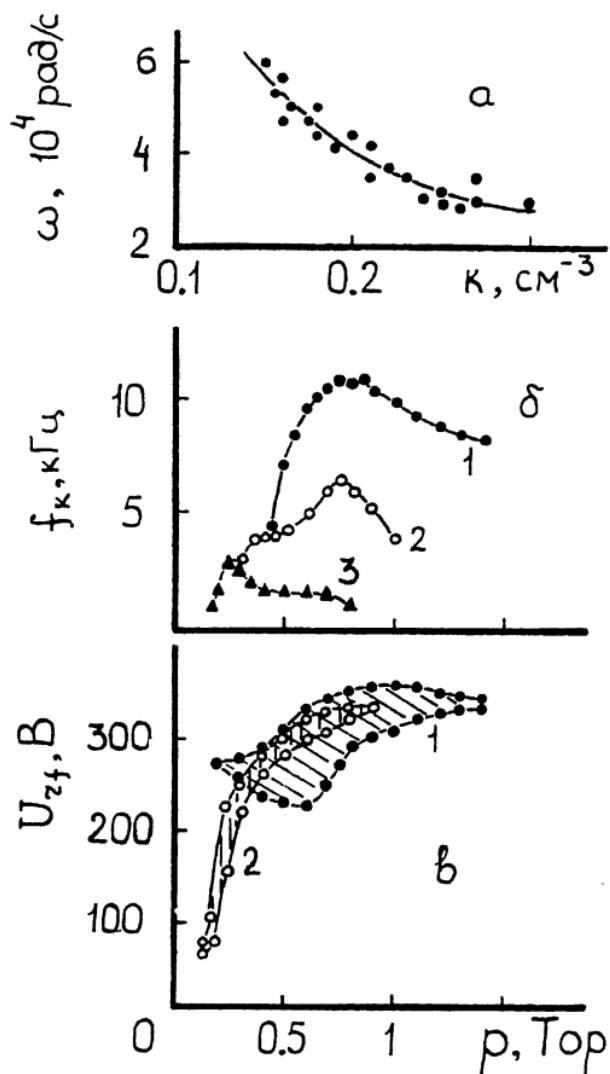


Рис. 2. а — закон дисперсии генерируемых НЧ колебаний в чистом аргоне; б — зависимость частоты НЧ колебаний от давления газа при концентрации аргона в воздухе: 1 — 100%, 2 — 50%, 3 — 25%; в — область существования ионизационной неустойчивости: 1 — чистый аргон, 2 — 25% аргона в воздухе. $L = 5.3$ см.

блюдается (рис. 1, г). На рис. 2, б, в показаны зависимости частоты колебаний от давления смеси воздуха с аргоном, а также области существования ионизационной неустойчивости при различных концентрациях аргона в воздухе. Из рис. 2, б видно, что увеличение концентрации воздуха в аргоне приводит к снижению частоты колебаний. В чистом аргоне при $p < 0.5$ Тор — шумы и колебания. В то же время при концентрации аргона в воздухе 25% колебания совместно с шумами генерируются во всей области существования неустойчивости.

По-видимому, появление немонотонного поведения плотности плазмы в центре разряда вызвано экранировкой ВЧ поля областями повышенной плотности плазмы на границах приэлектродных слоев. При низких ВЧ напряжениях ионизация в основном происходит в разрядном объеме (α — режим разряда), электроны набирают энергию в достаточно большом ВЧ поле в квазинейтральной плазме. Повышение ВЧ напряжения приводит к увеличению потока ионов из плазмы на электроды. Поскольку инертные газы имеют достаточно большой коэффициент ион-электронной эмиссии, то в аргоне ВЧ разряд переходит в γ -режим при довольно низких ВЧ напряжениях ($U_{rf} \sim 200$ В). Когда разряд переходит в γ -режим, на границах приэлектродных слоев образуются области повышенной плотности плазмы и ВЧ поле "вытесняется" из плазмы в слои. При низких давлениях фарадеевы темные пространства (ФТП) ВЧ разряда соприкасаются в центре промежутка, а ПС отсутствует [15]. В ФТП весьма низки амплитуда поля и T_e , следовательно, ионизация атомов газа электронами невелика. Заряженные частицы в разрядном объеме теряются из-за рекомбинации электронов с ионами и диффузии частиц на стенки трубы в радиальном направлении, поэтому сильное снижение ионизации в плазме приводит к заметному уменьшению n_i в центре разряда. Такое состояние разряда является неустойчивым, поэтому в плазме возникают шумы. При более высоких давлениях в центре разряда появляется ПС, который, как известно, при неблагоприятных условиях стратифицируется. Поэтому в разряде генерируются низкочастотные колебания. Когда диффузия заряженных частиц от границ приэлектродных слоев в центр разряда и ионизация атомов газа пучками быстрых электронов компенсируют снижение ионизации газа из-за экранировки ВЧ поля, n_i в центре разряда начинает расти и ионизационная неустойчивость исчезает.

Таким образом, в настоящей работе обнаружена область немонотонного поведения плотности плазмы в центре ВЧ разряда низкого давления. Получено также, что в этой

области в разряде возникает ионизационная неустойчивость (плазменные шумы и колебания, бегущие страты).

Список литературы

- [1] Левитский С.М. // ЖТФ. 1957. Т. 27. С. 1001.
- [2] Яценко Н.А. // ЖТФ. 1981. Т. 51. С. 1195; 1982. Т. 52. С. 1220; 1988. Т. 58. С. 294.
- [3] Яценко Н.А. // Препринт ИПМ АН СССР. № 338. 1988. 44 с.; № 381. 1989. 36 с.; № 465. 1990. 24 с.
- [4] Godyak V.A., Khanneh A.S. // IEEE Trans. Plasma Sci. 1986. V. 14. P. 112.
- [5] Vidaud P., Durrani S.M.A., Hall D.R. // J. Phys. D. 1988. V. 21. P. 57.
- [6] Кропотов Н.Ю., Лисовский В.А., Егоренков В.Д., Фареник В.И. // Матер. 2 Всесоюз. совещ. по высокочастотному разряду в волновых полях. Куйбышев, 1989. С. 16.
- [7] Кропотов Н.Ю., Лисовский В.А., Качанов Ю.А., Егоренков В.Д., Фареник В.И. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 21. С. 17.
- [8] Bohm Ch., Perrin J. // J. Phys. D. 1991. V. 24. P. 865.
- [9] Зайцев А.А., Джернетов Х.А., // ЖЭТФ. 1953. Т. 24. С. 516.
- [10] Зайцев А.А., Швилкин Б.Н. // Радиотехника и электроника. 1967. Т. 12. С. 736.
- [11] Недоспасов А.В. // УФН. 1968. Т. 94. С. 439.
- [12] Пекарек Л. // УФН. 1968. Т. 94. С. 463.
- [13] Зайцев А.А., Саевиченко И.А. // ЖТФ. 1975. Т. 45. С. 1541.
- [14] Ланда П.С., Мискинова Н.А., Пономарев Ю.В. // УФН. 1980. Т. 132. С. 601.
- [15] Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н. // Физика плазмы. 1992. Т. 18. С. 1476.

Поступило в Редакцию
11 августа 1993 г.